

「次世代半導体材料・プロセス基盤(MIRAI)プロジェクト」(事後評価)
評価コメント及び評点票 (案)

委員名 _____

コメントして頂く際の留意点

1. 評価項目に対して、説明・配布資料等（事業原簿、基本計画、パワーポイント資料）に基づき、評価コメントの作成及び評点付けをお願い致します。
2. 評価コメント作成にあたりましては、単に「妥当である。評価できる。」という表現だけではなく、可能な限り、妥当である理由、評価できる理由などについて、具体的な記述をお願い致します。
3. 評価コメントは評価報告書に掲載され、公開されることになりますが、「知的財産保護のため非公開とすべき事項」、「自主的企業活動に影響を及ぼすおそれのある事項」、「個人情報に関すること」、「差別的表現」、「事実と相異する意見」等、その影響を考慮して一定の配慮が必要な場合は、コメントの趣旨に反することのない範囲で、評価事務局からコメントの変更等をお願いする場合があります。
4. 評点付けにあたりましては、各評価項目について4段階（A、B、C、D）で評価をお願い致します。
5. 後日、メールにて本文ファイル（Word 形式）を送付致します。本電子ファイルにご記入頂き、下記の担当宛に電子メール、或いはFAXにてご返送頂けますようお願いします。

記

期 限： 平成 23 年 5 月 9 日（月）まで

送付先： 〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町 1310

ミューザ川崎セントラルタワー20F

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

評価部 室井和幸 宛

TEL : 044-520-5161

FAX : 044-520-5162

E-mail : muroikzy@nedo.go.jp

以上

「次世代半導体材料・プロセス基盤(MIRAI)プロジェクト」(事後評価)に対する
コメント及び評点票

*注意：「枠」の大きさにとらわれずコメントをお願いいたします。

(“3行以内” ということではございません。以下コメントも全て同様です。)

【I. 総論】

I -1. 総合評価

【評価委員コメント欄】

<肯定的意見>

<問題点・改善すべき点>

<その他の意見>

I -2. 今後の提言

【評価委員コメント欄】

<今後に対する提言>

<その他の意見>

* 「今後に対する提言」は、実施内容に関する提言の他、技術開発成果をマーケットにつなげるために必要な法規制の改正、国際標準化施策なども含め、幅広くご提言頂ければ幸いでございます。

【II. 各論】

II-1.事業の位置付け・必要性について

(1) NEDOの事業としての妥当性

- ・ 「ITイノベーションプログラム」、および「エネルギーイノベーションプログラム」の下で、当該施策・制度の目標達成のために寄与しているか。
- ・ 民間活動のみでは改善できないものであること、又は公共性が高いことにより、NEDOの関与が必要とされる事業か。
- ・ 当該事業を実施することによりもたらされる効果が、投じた予算との比較において十分であるか。

(2)事業目的の妥当性

- ・ 内外の技術開発動向、国際競争力の状況、エネルギー需給動向、市場動向、政策動向、国際貢献の可能性等から見て、事業の目的は妥当か。

【評価委員コメント欄】

<肯定的意見>

<問題点・改善すべき点>

<その他の意見>

II-2.研究開発マネジメントについて

(1)研究開発目標の妥当性

- ・ 内外の技術動向、市場動向等を踏まえて、戦略的な目標が設定されているか。
- ・ 具体的かつ明確な開発目標を可能な限り定量的に設定しているか。
- ・ 目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。

(2)研究開発計画の妥当性

- ・ 目標達成のために妥当なスケジュール、予算（各個別研究テーマ毎の配分を含む）となっているか。
- ・ 目標達成に必要な要素技術を取り上げているか。
- ・ 研究開発フローにおける要素技術間の関係、順序は適切か。

- ・ 継続プロジェクトや長期プロジェクトの場合、技術蓄積を、実用化の観点から絞り込んだうえで活用が図られているか。

(3)研究開発実施の事業体制の妥当性

- ・ 適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか。
- ・ 真に技術力と事業化能力を有する企業を実施者として選定しているか。
- ・ 全体を統括するプロジェクトリーダー等が選任され、十分に活躍できる環境が整備されているか。
- ・ 目標達成及び効率的実施のために必要な実施者間の連携または競争が十分に行われる体制となっているか。
- ・ 実用化シナリオに基づき、成果の受け取り手（ユーザー、活用・実用化の想定者等）に対して、関与を求める体制を整えているか。

(4) 研究開発成果の実用化、事業化に向けたマネジメントの妥当性

- ・ 成果の実用化、事業化につなげる戦略が明確になっているか。
- ・ 成果の実用化、事業化につなげる知財マネジメントの方針が明確に示され、かつ妥当なものか。

(5)情勢変化への対応等

- ・ 進捗状況を常に把握し、社会・経済の情勢の変化及び政策・技術動向に機敏かつ適切に対応しているか。
- ・ 計画見直しの方針は一貫しているか（中途半端な計画見直しが研究方針の揺らぎとなっていないか）。計画見直しを適切に実施しているか。

【評価委員コメント欄】

<肯定的意見>

<問題点・改善すべき点>

<その他の意見>

II-3.研究開発成果について

(1)目標の達成度

- ・ 成果は目標値をクリアしているか。
- ・ 全体としての目標達成はどの程度か。
- ・ 目標未達成の場合、目標達成までの課題を把握し、課題解決の方針が明確になっているか。

(2)成果の意義

- ・ 成果は市場の拡大或いは市場の創造につながることが期待できるか。
- ・ 成果は、世界初あるいは世界最高水準か。
- ・ 成果は、新たな技術領域を開拓することが期待できるか。
- ・ 成果は汎用性があるか。
- ・ 投入された予算に見合った成果が得られているか。
- ・ 成果は、他の競合技術と比較して優位性があるか。

(3)知的財産権等の取得及び標準化の取組

- ・ 知的財産権等の取扱（特許や意匠登録出願、著作権や回路配置利用権の登録、品種登録出願、営業機密の管理等）は事業戦略、または実用化計画に沿って国内外に適切に行われているか。
- ・ 得られた研究開発の成果に基づく国際標準化に向けた提案等の取組が適切に行われているか。

(4)成果の普及

- ・ 論文の発表は、研究内容を踏まえ適切に行われているか。
- ・ 成果の受取手（ユーザー、活用・実用化の想定者等）に対して、適切に成果を普及しているか。また、普及の見通しは立っているか。
- ・ 一般に向けて広く情報発信をしているか。

【評価委員コメント欄】

<肯定的意見>

<問題点・改善すべき点>

<その他の意見>

II・4. 実用化、事業化の見通しについて

(1) 成果の実用化可能性

- ・ 産業技術としての見極め（適用可能性の明確化）ができているか。
- ・ 実用化に向けて課題が明確になっているか。課題解決の方針が明確になっているか。
- ・ 国際規格化等、標準整備に向けた見通しが得られているか。

(2) 事業化までのシナリオ

- ・ NEDO後継プロジェクト、NEDO実用化助成、企業内研究等、プロジェクト終了後の事業化までの道筋は明確か。
- ・ 市場の規模や成長性、コストダウン、競合技術との比較、導入普及、事業化までの期間、事業化とそれに伴う経済効果等の見通しは立っているか。

(3) 波及効果

- ・ 成果は関連分野への波及効果（技術的・経済的・社会的）を期待できるものか。
- ・ プロジェクトの実施自体が当該分野の研究開発や人材育成等を促進するなどの波及効果を生じているか。

【評価委員コメント欄】

<肯定的意見>

<問題点・改善すべき点>

<その他の意見>

(個別テーマに関するコメント票)

1. 新構造極限 CMOS トランジスタ関連技術開発

- ・「研究開発成果」、「実用化、事業化の見通し」、「今後に対する提言」を含めてご記入ください。なお、評価基準は5～6頁と同じです。

【評価委員コメント欄】

<肯定的意見>

<問題点・改善すべき点>

<その他の意見>

2. 新探究配線技術開発

・「研究開発成果」、「実用化、事業化の見通し」、「今後に対する提言」を含めてご記入ください。なお、評価基準は5～6頁と同じです。

【評価委員コメント欄】

<肯定的意見>

<問題点・改善すべき点>

<その他の意見>

3. 特性ばらつきに対し耐性の高いデバイス・プロセス技術開発

・「研究開発成果」、「実用化、事業化の見通し」、「今後に対する提言」を含めてご記入ください。なお、評価基準は5～6頁と同じです。

【評価委員コメント欄】

<肯定的意見>

<問題点・改善すべき点>

<その他の意見>

4. 次世代マスク基盤技術開発

・「研究開発成果」、「実用化、事業化の見通し」、「今後に対する提言」を含めてご記入ください。なお、評価基準は5～6頁と同じです。

【評価委員コメント欄】

<肯定的意見>

<問題点・改善すべき点>

<その他の意見>

5. EUV 光源高信頼化技術開発

・「研究開発成果」、「実用化、事業化の見通し」、「今後に対する提言」を含めてご記入ください。なお、評価基準は5～6頁と同じです。

【評価委員コメント欄】

<肯定的意見>

<問題点・改善すべき点>

<その他の意見>

第Ⅰ～Ⅲ期を通した MIRAI プロジェクト全体に対する提言

【評価委員コメント欄】

<プロジェクト全体に対する提言>

評点法

【記入方法、結果取扱いについて】

- 各委員からは、各項目について、A、B、C、Dのいずれかを記入してください。
- 各委員記入の結果（素点）は、「参考」として公表（匿名）いたします。

(1) 事業の位置付け・必要性について

A B C D

＜判定基準＞

- 非常に重要 → A
- 重要 → B
- 概ね妥当 → C
- 妥当性がない又は失われた → D

(2) 研究開発マネジメントについて

A B C D

＜判定基準＞

- 非常によい → A
- よい → B
- 概ね適切 → C
- 適切とはいえない → D

(3) 研究開発成果について

A B C D

＜判定基準＞

- 非常によい → A
- よい → B
- 概ね妥当 → C
- 妥当とはいえない → D

(4) 実用化、事業化の見通しについて

A B C D

＜判定基準＞

- 明確 → A
- 妥当 → B
- 概ね妥当であるが、課題あり → C
- 見通しが不明 → D

以上

「次世代半導体材料・プロセス基盤(MIRAI)プロジェクト」(事後評価)に対する評点票

評価項目	評点	評価に当たっての考慮事項	評価(委員限り)
事業の位置付け・必要性 非常に重要 重要 概ね妥当 妥当性がない又は失われた	[A B C D] →A →B →C →D	NEDOの事業としての妥当性 事業目的の妥当性	[a b c d] [a b c d]
研究開発マネジメント 非常によい よい 概ね適切 適切とはいえない	[A B C D] →A →B →C →D	研究開発目標の妥当性 研究開発計画の妥当性 研究開発実施の事業体制の妥当性 研究開発成果の実用化に向けたマネジメントの妥当性 情勢変化への対応	[a b c d] [a b c d]
研究開発成果 非常によい よい 概ね妥当 妥当とはいえない	[A B C D] →A →B →C →D	目標の達成度 成果の意義 知的財産権等の取得及び標準化の取組 成果の普及	[a b c d] [a b c d] [a b c d] [a b c d]
実用化、事業化の見通し 明確 妥当 概ね妥当であるが、課題あり 見通しが不明	[A B C D] →A →B →C →D	成果の実用化可能性 事業化までのシナリオ 波及効果	[a b c d] [a b c d] [a b c d]

個別テーマの評点法

【記入方法、結果取扱いについて】

- 各委員からは、各項目について、A、B、C、Dのいずれかを記入してください。
- 各委員記入の結果（素点）は、「参考」として公表（匿名）いたします。

【以下は記入例です。次ページの評点票に評点をご記入ください】

<記入例>

(1) 研究開発成果について

<判定基準>

A	B	C	D
---	---	---	---

- 非常によい → A
- よい → B
- 概ね妥当 → C
- 妥当とはいえない → D

(2) 実用化、事業化の見通しについて

<判定基準>

A	B	C	D
---	---	---	---

- 明確 → A
- 妥当 → B
- 概ね妥当であるが、課題あり → C
- 見通しが不明 → D

個別テーマ 1. 新構造極限CMOSトランジスタ関連技術開発

評価項目	評点	評価に当たっての考慮事項	評価(委員限り)
研究開発成果	[A B C D]		
非常によい →A		目標の達成度	[a b c d]
よい →B		成果の意義	[a b c d]
概ね妥当 →C		知的財産権等の取得及び標準化の取組	[a b c d]
妥当とはいえない →D		成果の普及	[a b c d]
実用化、事業化の見通し	[A B C D]		
明確 →A		成果の実用化可能性	[a b c d]
妥当 →B		事業化までのシナリオ	[a b c d]
概ね妥当であるが、課題あり →C		波及効果	[a b c d]
見通しが不明 →D			

個別テーマ 2. 新探究配線技術開発

評価項目	評点	評価に当たっての考慮事項	評価(委員限り)
研究開発成果	[A B C D]		
非常によい →A		目標の達成度	[a b c d]
よい →B		成果の意義	[a b c d]
概ね妥当 →C		知的財産権等の取得及び標準化の取組	[a b c d]
妥当とはいえない →D		成果の普及	[a b c d]
実用化、事業化の見通し	[A B C D]		
明確 →A		成果の実用化可能性	[a b c d]
妥当 →B		事業化までのシナリオ	[a b c d]
概ね妥当であるが、課題あり →C		波及効果	[a b c d]
見通しが不明 →D			

個別テーマ 3. 特性ばらつきに対し耐性の高いデバイス・プロセス技術開発

評価項目	評点	評価に当たっての考慮事項	評価(委員限り)
研究開発成果	[A B C D]		
非常によい →A		目標の達成度	[a b c d]
よい →B		成果の意義	[a b c d]
概ね妥当 →C		知的財産権等の取得及び標準化の取組	[a b c d]
妥当とはいえない →D		成果の普及	[a b c d]
実用化、事業化の見通し	[A B C D]		
明確 →A		成果の実用化可能性	[a b c d]
妥当 →B		事業化までのシナリオ	[a b c d]
概ね妥当であるが、課題あり →C		波及効果	[a b c d]
見通しが不明 →D			

個別テーマ 4. 次世代マスク基盤技術開発

評価項目	評点	評価に当たっての考慮事項	評価(委員限り)
研究開発成果	[A B C D]		
非常によい →A		目標の達成度	[a b c d]
よい →B		成果の意義	[a b c d]
概ね妥当 →C		知的財産権等の取得及び標準化の取組	[a b c d]
妥当とはいえない →D		成果の普及	[a b c d]
実用化、事業化の見通し	[A B C D]		
明確 →A		成果の実用化可能性	[a b c d]
妥当 →B		事業化までのシナリオ	[a b c d]
概ね妥当であるが、課題あり →C		波及効果	[a b c d]
見通しが不明 →D			

個別テーマ 5. EUV光源高信頼化技術開発

評価項目	評点	評価に当たっての考慮事項	評価(委員限り)
研究開発成果	[A B C D]		
非常によい →A		目標の達成度	[a b c d]
よい →B		成果の意義	[a b c d]
概ね妥当 →C		知的財産権等の取得及び標準化の取組	[a b c d]
妥当とはいえない →D		成果の普及	[a b c d]
実用化、事業化の見通し	[A B C D]		
明確 →A		成果の実用化可能性	[a b c d]
妥当 →B		事業化までのシナリオ	[a b c d]
概ね妥当であるが、課題あり →C		波及効果	[a b c d]
見通しが不明 →D			

以上